

# Aka-Brief #12 材料: 700-2000HV

1



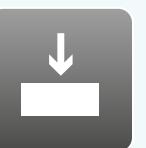
Piatto 220+



水



300 RPM



40 N



磨平



BF, 50x

2



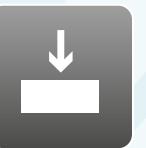
Allegran 6



DiaUltra  
9 µm



150 RPM



45 N



5 min\*



BF, 50x

3



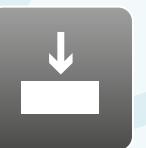
Allegran 3



DiaUltra  
3 µm



150 RPM



45 N



5 min\*



BF, 50x

4



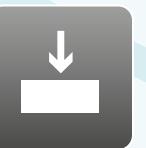
Silk



DiaUltra  
1 µm



150 RPM



30 N



5 min\*



BF, 50x

5



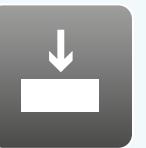
Chemal\*\*



Colloidal  
Silica 50 nm  
Alkaline



150 RPM



20 N



2 min\*



BF, 50x

图中所示时间与压力均适用于标准的300毫米制样系统和40毫米直径样品。

使用250毫米制样系统时，时间相应增加30%；使用200毫米制样系统时，时间相应增加 100%。

所使用的压力应随样品尺寸的增大和减小而进行相应的增大和减小。

样品夹/样品移动盘的转速为150转/分钟。

样品制备所需的时间和压力可能根据制样设备的不同而有所变化。

\* 根据所有制备的材料样品，可研磨和抛光的时间能需要调整。

\*\*开始氧化抛光之前，加水使整片抛光布湿透，样品夹/样品移动盘下移接触到抛光布时，停止加水。在氧化抛光的最后10秒，加水冲洗样品和抛光布。

# Aka-Brief #12 材料: 700-2000HV

## 最终制样结果

